

Рисунок 3 — Зависимость удельного расхода электроэнергии турбокомпрессора K500-61-5 от температуры воздуха после промежуточных воздухоохладителей

Таким образом, повышение температуры воздуха после промежуточных воздухоохладителей на 10° C, в диапазоне давлений 0,7–0,8 МПа приводит к увеличению удельного расхода электроэнергии в среднем на 0,6–0,8 %.

УДК 621.793

Кирилюк А.В.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ

БНТУ, Минск Научный руководитель: Латушкина С.В.

При разработке технологий получения сверхтонких плèнок сталкиваются с рядом проблем: качество полученной плèнки зависит от выбранного метода создания плèнки; недостаточная воспроизводимость результатов во всех существующих технологиях и нестабильность свойств плèнок во времени, что

обусловлено особенностями фазовых и структурных состояний вещества в тонких пленках.

Для контроля толщины оптических покрытий в процессе их осаждения в вакууме используются различные методы, среди которых рентгенографические методы, радиочастотный метод и фотометрические методы контроля толщины слоя.

Наиболее точные измерения толщины для тонких металлических пленок используют рентгеновские лучи. Наиболее ранним методом измерения толщины был метод поглощения, который основан на измерении ослабления в пленке соответствующего пучка рентгеновских лучей, дифрагированных кристаллической подложкой. Имеются серьезные ограничения этого метода, так как на измерение интенсивности оказывают влияние характеристики пленки, такие как: размер кристаллитов, напряжения и предпочтительная ориентация. Он может быть применен тогда, когда подложка содержит значительное количество элементов присутствующих в пленке. Видоизмененный метод поглощения заключается в измерении ослабления в пленке характеристического излучения материала подложки. Ослабление для данной длины волны является экспоненциальной функцией толщины пленки и зависит от коэффициента объемного поглощения материала пленки. Он не подвержен влиянию не основных примесей.

Интервал измеряемых толщин зависит от энергии излучения подложки и коэффициента поглощения плѐнки. Обычно он используется для толстых однокомпонентных плѐнок (от 100 нм до 1000 мкм) с точностью $\pm 5\%$. Этот метод не обладает избирательностью в том смысле, что может быть измерена любая плѐнка, если ее подложка имеет характеристическое излучение, измеряемое после ослабления плѐнкой. Этот метод является одним из лучших неразрушающих методов для непрозрачных плѐнок. Наиболее широко применяются два метода контроля — радиочастотный (по изменению массы)

и фотометрический (по изменению коэффициента пропускания или отражения).

Радиочастотный метод основан на измерении изменения частоты колебаний кварцевого кристалла при осаждении на нем пленки напыляемого вещества. Изменение частоты колебаний кварцевого кристалла пропорционально изменению его массы. Следовательно, если известна масса осаждаемой пленки, ее плотность и площадь на которую она осаждается, тогда еѐ толщина легко определяется. Однако допущение, что плотность пленки постоянна по мере ее роста справедливо для металлических пленок, имеющих толщину более 20÷30 нм, а при меньших толщинах плотность пленки является функцией толщины. Чувствительность метода в основном определяется стабильностью частоты измерительного кварцевого генератора и эталона частоты. Используемые приборы при рабочей частоте 20 МГц дают возможность определить сдвиг частоты на 2 Гц, что позволяет измерять приращение массы 10-10 г/см. Поскольку кристаллы кварца чувствительны к изменениям температуры, а при напылении испарители выделяют значительное количество тепла, то необходимо применение системы охлаждения для датчиков.

Фотометрический метод основан на контроле изменения коэффициента пропускания или отражения на контрольной длине волны или на нескольких длинах волн. Точностные возможности и диапазон контролируемых толщин пленок зависит не только от точности измерения коэффициентов пропускания и отражения, но и от методологии проведения контроля. Данный метод позволяет контролировать и оптические постоянные слоя. В обоих выше изложенных методах контроля толщины слоя на существующем уровне развития техники легко реализуется автоматическое окончание осаждения слоя, что позволяет исключить ошибку оператора. Это особенно важно при изготовлении многослойных покрытий

и покрытий, изготавливаемых с высокой скоростью осаждения (единицы секунд), например полупрозрачных слоев металлов. Фотометрические методы позволяют не только контролировать толщину слоя, но и отслеживать изменение оптических постоянных слоя в процессе его роста. В настоящее время существуют различные схемы проведения фотометрических измерений. Наиболее универсальной системой контроля можно считать схему, позволяющую проводить автоматический контроль осаждения, с использованием двух источников излучения и двух пар фотоприемников, реализующую одновременный контроль коэффициентов пропускания и отражения на двух длинах волн или коэффициентов пропускания, отражения и обратного отражения на одной длине волны.

Поскольку во время испарения происходит постоянная фоновая засветка фотоприемников излучением испарителей, то измерения необходимо проводить, модулируя излучение источников света. Поскольку необходимо проводить 10 и более измерений в секунду, необходима частота модуляции 10÷30 кГц.

Также используются системы контроля оптических характеристик на основе современной компьютерной диагностики. Решение этой задачи обеспечивают оптоволоконные спектрометры компании Avantes B.V., оснащенные специализированной системой измерения толщины тонких пленок AvaSpecThinFilm в диапазоне от 10 нм до 50 мкм.

Принцип измерения толщины тонких плèнок AvaSpecThinFilm базируется на анализе параметров интерференции света, определяемых в процессе измерений фотометрических характеристик анализируемого объекта. Результаты интерференции света при помощи математической функции преобразуется в характеристики толщины плèнки. В случае системы с одиночным плèночным слоем толщина этого слоя может быть вычислена, если известны оптические характеристики материала плèнки и подложки [2].

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Данилин, Б.С. Вакуумное нанесение тонких плèнок / Б.С. Данилин. М.: Энергия, 1967. 120 с.
- 2. Борн, М. Основы оптики / М. Борн. М.: Наука, 1970. 856 с

УДК 621.793

Козел Е.И.

ПРОСВЕТЛЕННАЯ ОПТИКА

БНТУ, Минск Научный руководитель: Данильчик С.С.

Просветление оптики — это нанесение на поверхность линз, граничащих с воздухом, тончайшей пленки или нескольких пленок одна поверх другой. Это необходимо для увеличения светопропускания оптической системы. Показатель преломления таких пленок меньше показателя преломления стекол линз.

Просветляющие пленки уменьшают светорассеяние отражение падающего света от поверхности оптического элемента, соответственно улучшая светопропускание системы изображения. контраст оптического Просветленный объектив требует бережного обращения, так как пленки, нанесенные на поверхность линз, легко повредить. Кроме того, тончайшие пленки загрязнений (жир, масло) на поверхности просветляющего покрытия нарушают его работу отражение света от и резко увеличивают загрязненной поверхности. Следует пальцев помнить, что следы временем разрушают не просветление, только поверхность самого стекла. По методике нанесения и составу просветляющего покрытия просветление бывает физическим (напыление) и химическим (травление).